

[УДК 538.245:539.216]:620.18

©1995

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ АНИЗОТРОПИИ ТОНКИХ ФЕРРИТОВЫХ ПЛЕНОК

B.K. Карпасюк, B.C. Карташев

Астраханский государственный педагогический институт,
Астрахань, Россия

(Поступила в Редакцию 30 сентября 1994 г.
В окончательной редакции 1 марта 1995 г.)

Методами конверсионной мессбауэровской спектроскопии, рентгеновской дифрактометрии, фотоэлектронной спектроскопии и микрорентгеноспектрального анализа изучена связь магнитной анизотропии со структурными характеристиками эпитаксиальных пленок $Mg_pMn_qFe_{r-\square}O_4$ ($p+q+r=3$, $p < r/2$), выращенных на подложках из оксида магния ориентации (100) при температурах 1173–1373 К. Установлено, что перпендикулярной анизотропией обладают пленки с $q > 1$, $q/r > 1$ толщиной до 1.5 μm , полученные при скоростях роста менее 0.2 $\mu m/min$ и не содержащие двухвалентного железа. Такие пленки характеризуются наличием тетрагональных искажений кристаллической решетки, большим значением квадрупольного расщепления мессбауэровских линий в парамагнитной области температур и периодом решетки в направлении нормали 0.849–0.850 нм. Полученные результаты позволили заключить, что определяющую роль в формировании перпендикулярной анизотропии исследованных пленок играют тетрагональные искажения решетки ян–тэллеровскими ионами Mn^{3+} , повышенная концентрация катионных вакансий и содержание магния в переходном слое и в пленке.

Эпитаксиальные пленки ферритов со структурой шпинели обладают интересными магнитными, электрическими и оптическими свойствами, делающими эти материалы привлекательными для технических приложений и физических исследований [1–5]. Однако создание управляемой технологии получения шпинельных пленок в настоящее время проблематично, поскольку зависимости их параметров от состава, структуры и условий синтеза остаются все еще малоизученными. В частности, данные о природе перпендикулярной анизотропии (ПА) нередко противоречивы, что обусловлено, вероятно влиянием множества факторов и недостаточно полной аттестацией экспериментальных образцов.

Часто ПА в пленках ферритов–шпинелей связывается с магнитоупругим эффектом [1,2,6]. При этом считается, что упругие напряжения σ в пленке при комнатной температуре обусловлены различием параметров решетки пленки и подложки и/или различием их коэффициентов теплового расширения. Однако ряд данных [3,5,7–9] противоречит этим представлениям и свидетельствует о вкладе в ПА дефектности

и искажений симметрии кристаллической решетки. В [9,10] высказано предположение о том, что причиной одноосной анизотропии пленок марганцевого феррита $Mn_xFe_{3-x}O_4$ ($x > 1.6$) может быть кооперативный эффект Яна-Теллера, вызываемый ионами Mn^{3+} в октаэдрической координации. Автором работ [11,12] наличие одноосной анизотропии эпитаксиальных кристаллов феррита марганца при $1 \leq x \leq 1.8$ связывается с упорядочением магнитно-одноосных кластеров, содержащих пары катионов $Mn^{3+}-Fe^{2+}$.

Полученные нами результаты говорят о возможности существования ПА в пленках на основе марганцевого феррита, не содержащих двухвалентного железа, но имеющих в составе ионы Mn^{3+} и Mg^{2+} .

1. Экспериментальные образцы и методы их исследования

Пленки Mg–Mn ферритов были получены методом химических газотранспортных реакций в малом зазоре на подложках из оксида магния ориентации (100). В качестве исходного материала использовалась смесь оксидов после предварительной ферритизации, соответствующая по составу моноферриту марганца $MnFe_2O_4$. Для увеличения эффекта резонансного поглощения гамма-квантов исходный материал обогащался изотопом ^{57}Fe до 10%. Температура синтеза пленок изменилась в диапазоне 1173–1373 К, давление газа-носителя, в качестве которого использовался хлористый водород, было равно 8 кРа, давление воздуха составляло 1–3 кРа.

Измерения состава и толщины пленок проводились на попеченных шлифах с помощью системы растровой электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа «Камебакс». С целью обеспечения электропроводности на образцы был напылен слой алюминия толщиной около 10 нм.

Для получения мессбауэровских спектров использовался спектрометр ЯГРС-4, работающий в режиме постоянных ускорений, с анализатором АИ-4096. Спектры пленок толщиной менее 4 μm были получены в режиме регистрации электронов конверсии с использованием проточного пропорционального счетчика, предложенного в [13]. Спектры более толстых пленок снимались также и в геометрии пропускания. Направление распространения гамма-квантов от источника (^{57}Co в матрице Pd) совпадало с нормалью к образцам. Определение равновесной ориентации намагниченности пленок производилось по отношению площадей второй (пятой) и первой (шестой) линий ($S_{2,5}/S_{1,6}$), зависящему от угла θ между направлением излучения и вектором внутриструктурного магнитного поля на ядре ^{57}Fe [14],

$$R = S_{2,5}/S_{1,6} = \frac{4}{3} \frac{\sin^2 \theta}{1 + \cos^2 \theta}. \quad (1)$$

Монокристалличность эпитаксиальных слоев подтверждалась картиками дифракции медленных электронов на поверхности пленок, а также рентгеновскими дифрактограммами. Рентгеноструктурные исследования проводились на дифрактометре ДРОН-3. Изучение дифракции медленных электронов и получение рентгеновских фотоэлектронных спектров осуществлялись на оборудовании «Микролаб МК-11».

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Данные дифракционных исследований показали, что эпитаксиальные слои являются монокристаллическими и имеют шпинельную структуру. Параметр кристаллической решетки пленок изменяется в зависимости от условий синтеза в диапазоне 0.845–0.850 nm.

В таблице приведены средние значения эффективного магнитного поля на ядрах H_{eff} , квадрупольного расщепления ΔE и изомерного сдвига δ при 300 K для пленок толщиной h , полученных при различных скоростях роста V_g . Как видно из этой таблицы, при повышении скорости роста параметры спектров пленок приближаются к параметрам массивных образцов марганцевого феррита [14], причем H_{eff} увеличивается. Это обусловливается изменением коэффициентов переноса железа и марганца, а также уменьшением степени легирования пленок магнием [12, 15, 16].

На рис. 1 показаны мессбауэровские спектры пленок, выращенных при различных V_g и имевших толщину 5.6 (a), 1 (b), 0.1 μm (c). С уменьшением скорости роста пленок наблюдается уменьшение интенсивности второй и пятой линий спектров, а на начальной стадии роста (при толщине пленок 0.1 μm и менее) образуется парамагнитный слой вследствие взаимной диффузии компонентов пленки и подложки.

Зависимость отношения площадей линий $S_{2,5}/S_{1,6}$ от скорости роста пленок приведена на рис. 2. Как видно из графика, при скоростях менее 0.2 $\mu\text{m}/\text{min}$ $R = 0$, и, следовательно, осью легкого намагничивания является нормаль к плоскости пленки.

В парамагнитной области температур ($T = 573$ K) значение квадрупольного расщепления для октаэдрической подрешетки составляет не менее 0.67 ± 0.05 mm/s у пленок с ПА и не превышает 0.45 ± 0.05 mm/s у пленок, не обладающих ПА.

По данным рентгеноспектрального микроанализа, состав пленок относится к области $p < r/2$ системы $\text{Mg}_p\text{Mn}_q\text{Fe}_r\text{O}_4$ ($p+q+r=3$) [17] (при стехиометрическом содержании кислорода). Для пленок с ПА $q > 1$, $q/r > 1$. Согласно спектрам рентгеновских фотоэлектронов и значениям изомерного сдвига ($\delta = 0.01$ – 0.1 mm/s), в пленках с ПА все железо находится в трехвалентном состоянии (ионы Fe^{2+} отсутствуют). Значения параметра кристаллической решетки пленок, обладающих ПА, измеренные по отражениям от плоскостей, параллельных гетерогранице, составляют 0.849–0.850 nm, причем на дифрактограммах имеются также рефлексы, соответствующие шпинельной фазе с параметром решетки 0.8466–8470 nm. Температурные коэффициенты линейного расширения для подложки и пленок в диапазоне температур 293–773 K

Параметры мессбауэровских спектров пленок ($T = 300$ K) в зависимости от скорости роста и толщины

V_g , $\mu\text{m}/\text{min}$	h , μm	H_{eff} , kOe	ΔE , mm/s	δ , mm/s
0.13	1.3	420 ± 5	0.11 ± 0.04	0.04 ± 0.03
0.25	2.0	441 ± 5	0.04 ± 0.05	0.10 ± 0.03
0.28	2.8	441 ± 5	0.02 ± 0.02	0.10 ± 0.03
0.50	3.0	459 ± 3	0.05 ± 0.05	0.16 ± 0.05
1.50	3.0	470 ± 3	0.07 ± 0.05	0.07 ± 0.05

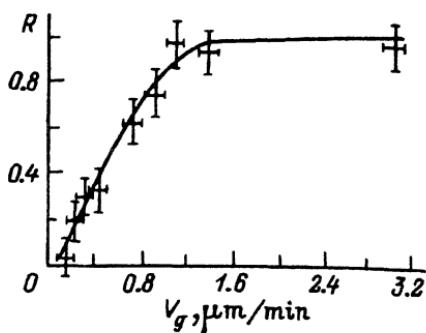
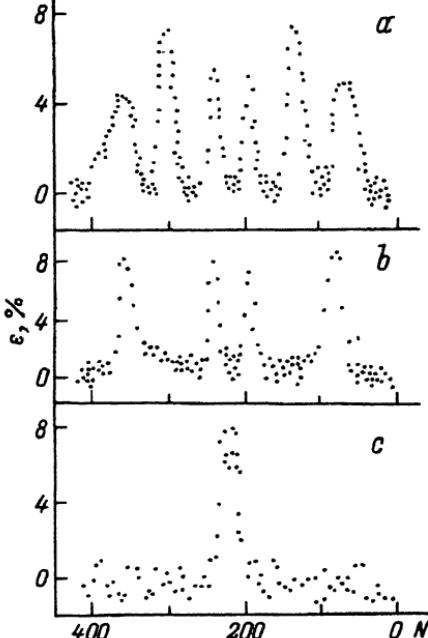


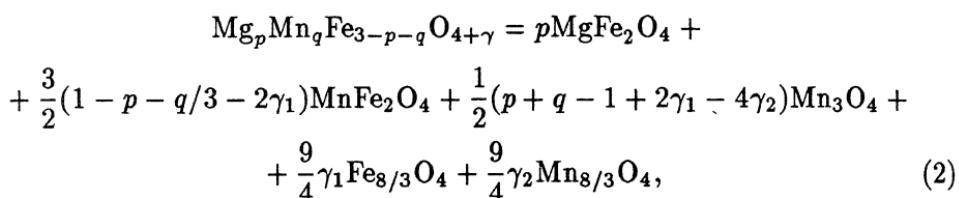
Рис. 2. Зависимость отношения площадей линий $R = S_{2,5}/S_{1,6}$ от скорости роста пленок V_g .

Рис. 1. Конверсионные электронные мессбауэровские спектры (ϵ — величина эффекта, N — номера каналов) ферритовых пленок, полученных при различной скорости роста V_g .

V_g ($\mu\text{m}/\text{min}$): а — 1, б — 0.2, в — 0.02.

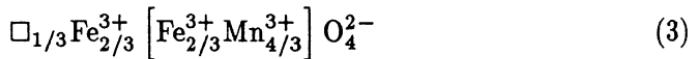
практически постоянны и равны $12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ и $11.6 - 11.8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ соответственно (максимальная температура измерений ограничивается диффузионными процессами в системе пленка-подложка).

Согласно [18, 19], в области гомогенности ферриты полученных составов с учетом отклонения от стехиометрии по кислороду (γ) могут быть представлены в виде следующих твердых растворов:



где $\gamma_1 + \gamma_2 = \gamma$.

Растворы (2) содержат катионные ваканции, поскольку гамма-оксиды железа и марганца являются шпинелями, имеющими дефекты в окта- и тетраподрешетке, соответственно [19]. С учетом представлений о вакансиионном механизме перераспределения катионов по подрешеткам естественно считать, что ионы Mn^{3+} , обладающие большой энергией предпочтения к октаэдрическому окружению, могут заполнять ваканции в структуре гамма-оксида железа, образуя кластеры типа



с параметром решетки около 0.840 nm [19]. В (3) квадратными скобками обозначены октаэдрические позиции катионов, \square — ваканции. Повышенная концентрация таких кластеров легко реализуется в шпинельной структуре, при этом количество катионов Mn^{3+} в октаэдрических позициях увеличивается.

Параметры кристаллической решетки твердых растворов (2) для пленок с ПА, вычисленные по правилу аддитивности с использованием параметров компонентов, приведенных в [19], находятся в интервале 0.847–0.848 нм, т.е. превышают удвоенный параметр решетки MgO (0.8432 нм). Оценки знака упругих напряжений на основе теории [6] показали, что $\sigma < 0$, поэтому в пленках должны действовать напряжения сжатия, приводящие к их тетрагональной деформации с увеличением межплоскостного расстояния в направлении, перпендикулярном гетерогранице [20] (при отсутствии релаксации с образованием дислокаций несоответствия). Снижение упругой энергии пленок может обеспечиваться за счет тетрагональных искажений кубической шпинельной решетки ян–теллеровскими ионами Mn³⁺ [9,10,21]. Такое предположение подтверждается тремя факторами: 1) ПА наблюдается только в пленках с отношением at.% Mn/Fe > 1; 2) у пленок с ПА значение параметра решетки в направлении нормали превышает максимальную величину параметра неискаженной решетки (0.848 нм); 3) квадраупольное расщепление, чувствительное к изменению симметрии кристаллической решетки, имеет большую величину у пленок с ПА. Следствием эффекта Яна–Теллера, как указано в [22], может быть поворот оси кристаллографической магнитной анизотропии шпинелей из направления [111] в направление [100].

Следует также отметить существенное влияние ионов магния на формирование ПА [16]. Поскольку в процессе синтеза пленок наблюдается интенсивная диффузия магния в пленку, то при скоростях роста менее 0.2 $\mu\text{m}/\text{min}$ образуется протяженный переходной слой с достаточно высокой концентрацией магния, что приводит к уменьшению параметра решетки, упругих напряжений и намагниченности насыщения. При повышении скорости роста концентрация магния уменьшается, напряжения сжатия возрастают, могут возникнуть дислокации несоответствия, а сохранение скорости роста при увеличении времени синтеза приводит также к генерации дислокаций несоответствия вплоть до сдвига кристаллографических плоскостей [20]. Поэтому ПА наблюдается в пленках с толщиной, не превышающей 1.5 μm , а с увеличением толщины величина тетрагональной деформации уменьшается. Подобные закономерности возникновения дислокаций несоответствия и поведения тетрагональной деформации являются достаточно общими для гетероэпитаксиальных слоев [20]. Пленки с отношением $q/r > 1$, но толщиной более 2 μm не обладают ПА при указанных выше режимах синтеза и значениях параметра решетки. С повышением ростовой температуры до 1473 К концентрация магния в переходном слое и толщина последнего существенно возрастают, параметр решетки уменьшается и оказывается возможным возникновение одноосной анизотропии в пленках толщиной до 6 μm [16] (соотношение $q/r > 1$ при этом по-прежнему выполняется).

Относительно природы рефлексов шпинельной фазы с параметром решетки 0.8466–0.8470 нм можно предположить, что их происхождение обусловлено эффектом стабилизации состава эпитаксиального слоя, близкого к изопериодному с подложкой [20], в условиях спинодального распада. Образующаяся при этом одномерная модулированная структура представляет собой систему пластин шпинельных фаз с различной степенью тетрагональности [23]. Одна из таких фаз и имеет параметры $c \approx 0.8468 \text{ nm}$, $a \approx 2a_{\text{MgO}} = 0.8423 \text{ nm}$.

Полученные результаты позволяют выделить три наиболее существенных фактора, влияющих на формирование ПА тонких ферритовых (100)-пленок, выращенных на подложке из оксида магния и не содержащих двухвалентного железа: 1) концентрация ян-теллеровских ионов Mn^{3+} , определяющая возникновение тетрагональных искажений кристаллической решетки; 2) концентрация магния в пленке, влияющая на величину упругих напряжений и намагниченность насыщения M_s , от которых зависит фактор качества $Q = H_a/4\pi M_s$ (H_a — поле ПА) [24]; 3) концентрация вакансий, которая определяет скорость диффузии магния в пленку, содержание ионов Mn^{3+} в октаэдрической подрешетке твердого ферритообразующего раствора и образование кластеров (не исключена также роль возможного упорядочения вакансий [25]).

Отметим, что наши представления обобщают предположения работы [26] о том, что эпитаксиальная структура марганцевого феррита является твердым раствором гамма-оксидов железа и марганца, а также что взаимодействие с подложкой влияет на распределение катионов по подрешеткам и стабилизирует кристаллическую структуру пленки (в частности, тетрагональные искажения).

Список литературы

- [1] Baszyński J., Szymański B., Sulkowska S. Proc. Int. Conf. on Ferrites. Japan (1980). P. 494–496.
- [2] Van der Straten P.J.M., Metselaar R. J. Appl. Phys. **51**, 6, 3236 (1980).
- [3] Van der Straten P.J.M., Bondarenko V.V., Metselaar R. J. Cryst. Growth. **51**, 1, 119 (1981).
- [4] Карпасюк В.К., Картышев В.С., Лебедев А.В., Орлов Г.Н., Пимонов П.Я., Шепеткин А.А. Изв. АН СССР. Неорг. материалы **23**, 9, 1531 (1987).
- [5] Жигалов В.С., Фролов Г.Н., Вершинина Л.И. Изв. АН СССР. Неорг. материалы **28**, 5, 1077 (1992).
- [6] Besser P.J., Mee J.E., Elkins P.E., Heinz D.M. Mat. Res. Bull. **6**, 11, 1111 (1971).
- [7] Карташев В.С., Карпасюк В.К., Орлов Г.Н., Шепеткин А.А. Тез. науч. сообщений I Уральской конф. «Поверхность и новые материалы». Свердловск (1984). Ч. 1. С. 123–124.
- [8] Карпасюк В.К., Карташев В.С. Тез. докл. Всерос. совещ. вузов по физике магнитных материалов. Астрахань (1989). С. 33–34.
- [9] Кичмаренко Ф.С., Кащаев А.А., Ивайлловская Л.И., Бондаренко Г.В. Сб. Ночные монокристаллы магнитно-упорядочивающихся веществ. Красноярск (1975). С. 57–60.
- [10] Šimša Z., Šimšová J., Suk K., Kratochvílova E., Maryško M. Phys. Stat. Sol. **34**, 2, 639 (1976).
- [11] Бабкин Е.В. Сб. Физика магнитных пленок. Иркутск (1979). С. 88–92.
- [12] Бабкин Е.В. Автореф. канд. дисс. Красноярск (1980).
- [13] Немошканенко В.В., Галушко Ю.В., Разумов О.Н., Томашевский Н.А. ПТЭ, 9, 39 (1983).
- [14] Башкиров Ш.Ш., Либерман А.Б., Синявский В.И. Магнитная микроструктура ферритов. Казань (1978). 182 с.
- [15] Карташев В.С., Карпасюк В.К., Орлов Г.Н., Шепеткин А.А. Сб. Получение и свойства ферритов. Свердловск (1987). С. 51–53.
- [16] Карташев В.С., Карпасюк В.К., Орлов Г.Н., Шепеткин А.А. Изв. АН СССР. Неорг. материалы **22**, 12, 2072 (1986).
- [17] Osmond W.P. Proc. Phys. Soc. **69**, Pt. 12, 444 B, 1319 (1956).
- [18] Карпасюк В.К., Орлов Г.Н., Шепеткин А.А., Чуфаров Г.И. ДАН СССР **254**, 3, 648 (1980).

- [19] Карпасюк В.К., Киселев В.Н., Орлов Г.Н., Щепеткин А.А. Электромагнитные свойства и нестехиометрия ферритов с прямоугольной петлей гистерезиса. М. (1985). 149 с.
- [20] Мильвидский М.Г., Освенский В.Б. Структурные дефекты в эпитаксиальных слоях полупроводников. М. (1985). 160 с.
- [21] Круничка С. Физика ферритов и родственных им магнитных окислов. М. (1976). Т. 1.
- [22] Greifer A.P. IEEE Trans. Magn. Mag-5, 4, 774 (1969).
- [23] Хачатуян А.Г. Теория фазовых превращений и структура твердых растворов. М. (1974). 384 с.
- [24] Балашов А.М., Червоненкис А.Я. Магнитные материалы для микроэлектроники. М. (1979). 216 с.
- [25] Takei H., Chiba S. J. Phys. Soc. Jap. 21, 7, 1255 (1966).
- [26] Паршин А.С., Чистяков Н.С. Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 17, 2, 346 (1981).